

Remover K

KMPR用レジスト剥離液

MICRO CHEM

NIPPON
KAYAKU

Remover K は KMPR 用の水系レジスト剥離液です。

狭ピッチ・高アスペクト比めっき対応の剥離液としてご使用いただけます。

Remover Kを用いた剥離工程は、はじめに、レジストを Remover PG にて膨潤させ、さらに、Remover K で酸化・分解剥離を行った後に、Neutralizer K で中和処理を行います。

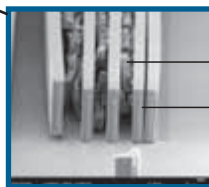
また、強固に架橋したフォトレジストの剥離にも有効です。ハードベークを行っていないSU-8の除去も可能なため、ウェハーのリワークにも使用することができます。

特 徴

- 水溶液タイプ
- 狭ピッチ・高アスペクト比対応
- 強固に架橋したフォトレジストに有効
- SU-8ウェハーリワーク

【膨潤剥離と酸化・分解剥離の違い】

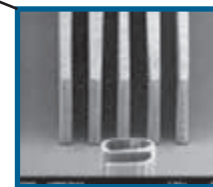
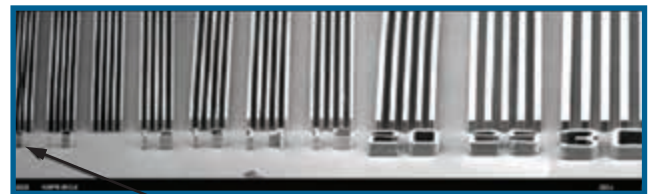
NMPベース剥離液



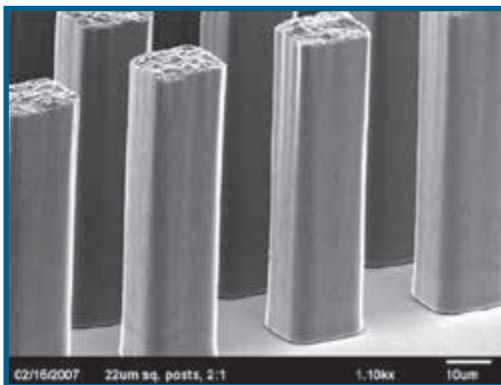
KMPR残渣
Cuめっき

Remover K*

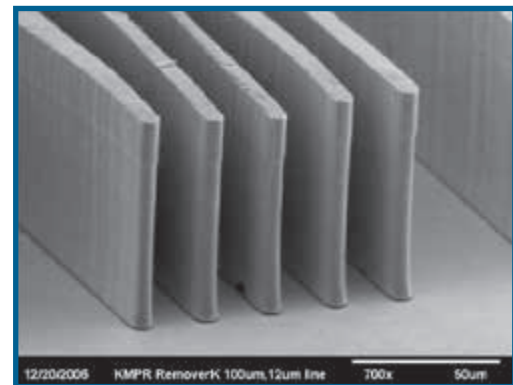
*Neutralizer K 処理後



【Remover Kを使用した例】



ニッケルめっき構造体
幅：22μm, 高さ：100μm



銅めっき構造体
幅：12μm, 高さ：100μm

(販売元) 日本化薬株式会社

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目1番1号
TEL. 03-6731-5266

製作：KMCC
2008.07.28